

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	備考(注1)	成果公開(注2)		
					機器利用	技術補助	技術代行(注3)
					(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	4,400	10,100	11,600
NPF003	イオンコーター	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	6,200	7,000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	4,400	10,100	12,400
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	3,300	9,000	11,300
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	7,700	13,400	14,900
NPF008	スピニングコーター	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置		500	6,200	7,000
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF010	マスクアラメント露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF011	i線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィ装置	技術代行専用	13,200	18,900	21,200
NPF012	ドラフトチャンバー(右)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置		500	6,200	7,000
NPF013	ドラフトチャンバー(左)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置		500	6,200	7,000
NPF014	有機ドラフトチャンパー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	6,200	7,000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンパー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	6,200	7,000
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置		500	6,200	7,000
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置		500	6,200	7,000
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR1 クリーンルーム	エッチング装置	有償トレーニング	2,700	8,400	9,900
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	有償トレーニング	7,000	12,700	14,200
NPF021	プラズマアッシャー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	6,200	7,000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	6,200	7,000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	4,900	10,600	12,100
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	2,500	8,200	9,700
NPF026	RF・DCスパッタ成膜装置(ULVAC)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,800	9,500	11,000
NPF027	ECRスパッタ成膜装置	2F 一般実験室	成膜装置	有償トレーニング	5,000	10,700	12,200
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	2,200	7,900	10,200
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	3,400	9,100	10,600
NPF031	原子層堆積装置[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	技術代行専用	4,400	10,100	11,600
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD付帯)	CR5 クリーンルーム	ミリング装置	有償トレーニング	2,500	8,200	9,700
NPF033	アルゴンミリング装置	CR5 クリーンルーム	ミリング装置	有償トレーニング	2,700	8,400	9,900
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	CR1 クリーンルーム	イオンビーム装置	技術代行専用	7,700	13,400	15,700
NPF035	イオンスパッタ(FIB付帯)	CR1 クリーンルーム	表面処理装置		500	6,200	7,000
NPF036	集束イオン/電子ビーム観察加工装置(FIB-SEM)	CR1 クリーンルーム	イオンビーム装置	技術代行専用	9,300	15,000	17,300
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	イオンビーム装置	技術代行専用	6,600	12,300	13,800
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	2F 一般実験室	表面処理装置		500	6,200	7,000
NPF040	多目的高速加熱ランプ炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF042	クリーンオープン右	CR2 イエロールーム	熱処理装置		500	6,200	7,000
NPF043	クリーンオープン左	CR2 イエロールーム	熱処理装置		500	6,200	7,000
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置		500	6,200	7,000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	プローブ装置		500	6,200	7,000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM1 [NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	有償トレーニング	2,700	8,400	10,700
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM2[SPM-9600/9700]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	有償トレーニング	2,700	8,400	10,700
NPF048	ナノサーチ顕微鏡SPM3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	有償トレーニング	3,300	9,000	11,300
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	技術代行専用	6,600	12,300	14,600
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	測定装置		500	6,200	7,000
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置		1,100	6,800	8,300
NPF053	ワイヤーボンダー	CR1 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	加工装置	有償トレーニング	3,300	9,000	11,300
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	加工装置		500	6,200	7,000
NPF056	研磨機	CR4 クリーンルーム	加工装置		1,100	6,800	8,300
NPF057	ラッピングマシン(CMP)	CR4 クリーンルーム	加工装置		2,200	7,900	9,400
NPF058	ウェハー圧着機	CR1 クリーンルーム	加工装置		500	6,200	7,000
NPF059	レーザー顕微鏡[VK-8510]	CR1 クリーンルーム	観察装置		1,600	7,300	8,100
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	1,900	7,600	8,400
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察装置	有償トレーニング	1,900	7,600	8,400
NPF062	全焦点顕微鏡	CR1 クリーンルーム	観察装置		1,600	7,300	8,100
NPF063	分光エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	分光装置	有償トレーニング	1,100	6,800	7,600
NPF064	解析用PC(分光エリブソメータ用)	2F データ解析室	分光装置		500	6,200	8,500
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	分光装置	有償トレーニング	3,400	9,100	10,600
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	分光装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF067	解析用PC(CADおよびSPM, FT-IR, Raman用)	2F データ解析室	分光装置		500	6,200	8,500
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	測定装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	エックス線装置	有償トレーニング	2,700	8,400	9,900

2018年度ナノプロセッシング施設（NPF）単価表

2018年4月1日設定

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	備考（注1）	成果公開（注2）		
					機器利用	技術補助	技術代行 （注3）
					（円/時間）	（円/時間）	（円/時間）
NPF071	薄膜エックス線回折装置	2F 一般実験室	エックス線装置	有償トレーニング	2,700	8,400	9,900
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	エックス線装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF073	解析用PC(CADおよびX線用)	2F データ解析室	エックス線装置		500	6,200	8,500
NPF074	エックス線光電子分光分析(XPS)装置	2F 一般実験室	エックス線装置	有償トレーニング	3,300	9,000	10,500
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	エックス線装置		500	6,200	8,500
NPF076	解析用PC(一般解析用)1	2F データ解析室	その他		500	6,200	8,500
NPF077	解析用PC(一般解析用)2	2F データ解析室	その他		500	6,200	8,500
NPF078	解析用PC(一般解析用)3	2F データ解析室	その他		500	6,200	8,500
NPF079	解析用PC(一般解析用)4	2F データ解析室	その他		500	6,200	8,500
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR産学官連携研究棟	観察装置	技術代行専用	-	-	16,000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置（SiN）	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	4,400	10,100	11,600
NPF082	化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）	CR5 クリーンルーム	リソグラフィ装置	技術代行専用	7,000	12,700	14,200
NPF083	多目的熱処理装置	CR5 クリーンルーム	熱処理装置		1,600	7,300	8,100
NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察装置		1,600	7,300	8,100
NPF085	物理特性測定装置（PPMS）	2F 一般実験室	測定装置	有償トレーニング	4,400	10,100	11,600
NPF086	マニュアルウエハプローパー（2F）	2F 一般実験室	ブローブ装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF087	ワイヤーボンダー（2F）	2F 一般実験室	ブローブ装置	有償トレーニング	1,600	7,300	8,800
NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡 [S4500/FE-SEM]（2F）	2F 一般実験室	観察装置	有償トレーニング	4,400	10,100	12,400
NPF089	赤外線ランプ拡散炉（RTA）	CR5 クリーンルーム	熱処理装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF90	レーザー加工装置	CR4 クリーンルーム	加工装置		1,600	7,300	8,800
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	7,500	13,200	14,700
NPF093	高速電子ビーム描画装置（エリオニクス）	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	有償トレーニング	20,700	26,400	27,900
NPF094	解析用PC（CAD及び近接効果補正用）	2F データ解析室	その他	有償トレーニング	2,200	7,900	9,400
NPF095	RF-DCスパッタ堆積装置（芝浦）	CR5 クリーンルーム	成膜装置	有償トレーニング	2,300	8,000	9,500
	有償トレーニング		その他				1,000 (1回)

装置番号：NPFで装置管理のために使用している番号

設置場所：装置が設置してある部屋

装置分類：装置の利用目的や原理に応じて分類された区分

（注1）「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、最初のご利用の前に有償のトレーニングを受講して頂いております。

「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。

（注2）成果非公開の単価表についてはNPF事務局（tia-npf-ml@aist.go.jp）まで別途お問い合わせください。

（注3）NPFのスタッフが他の施設（産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設）の装置の技術代行を行う場合は、装置の機器利用料に加え、一律8000円（成果公開）を加算致します。

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理致します。

※2018年度のご利用につきましては、ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数が掛かります。その他、支援形態や成果公開の可否によって課金額が変わることがございます。

詳しくはNPF事務局（tia-npf-ml@aist.go.jp）にお問い合わせください。

中小企業(中小企業支援法第2条参照) 0.5

大学及び公的研究機関 0.6（産総研所属の利用者はここに該当します。）

※その他に、来所して装置をご利用いただく場合は、ユーザーのご所属により、連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させていただいております。（<https://unit.aist.go.jp/cpiad/ci/procedure/seq/jutaku-keihi.pdf>）

詳細は、NPF事務局にお問い合わせ下さい。